

### MO-ZERO1SP



2~8" 対応

研究開発用に設計されたモデルです  
様々なアプリケーションに対応  
特殊ガスも使用できる装置です

### MO-ZERO2SPPlasma



2~8" 対応/プラズマ付

研究開発用に設計されたモデルです  
様々なアプリケーションに対応  
特殊ガスも使用できる装置です

### MO-ALD8000



30mm対応 / 8" ウェハ 24枚自動搬送  
クラスターツール付

PC レシビによる自動成膜  
MOガス、一般ガスの追加改造が可能です

### ALD System SPM580



N2レス オゾン方式/特殊ガス対応  
TMP+RP/基板加熱機構/自動成膜/カスタム可

¥ 15,000,000

### ALD System SPM560



レシビによる自動成膜  
Qマス付/基板加熱機構/TMP+RP/カスタム可

¥ 14,000,000

### ALD System SPM550



レシビによる自動成膜  
基板加熱機構/TMP+RP/カスタム可

¥ 12,000,000

### STD-CVD-M6CS



レシビによる自動成膜/Cat-CVD/プラズマ付  
基板加熱機構/TMP+RP/カスタム可

¥ 18,000,000 ~

### STD-CVD-M5CS



TMP+RP/基板加熱機構/自動成膜/カスタム可

¥ 16,000,000 ~

### SP200-S



小型RFスパッタ装置

2"スパッタ/基板加熱機構付/TMP+RP/カスタム可

¥ 4,500,000 ~

### SP400-S

UHV4元式スパッタ装置



3"スパッタ/基板加熱機構付/TMP+RP/カスタム可

¥ 25,000,000 ~

### SP600-S

UHV6元式スパッタ装置



2"スパッタ/基板加熱機構付/TMP+RP/カスタム可

¥ 28,000,000 ~

### SPE350

高速多元蒸着装置



タッチパネルひとつで簡単操作  
抵抗加熱式/フラット式/ボート式/TMP+RP/カスタム可

¥ 3,500,000 ~

### SP655

角型チャンバー式蒸着装置



EB/抵抗加熱式/スパッタ対応/基板加熱機構付  
TMP+RP/カスタム可

¥ 13,000,000 ~

### SP750

高速多元蒸着装置



EB/抵抗加熱式/スパッタ対応/基板加熱機構スライド式  
TMP+RP/カスタム可

¥ 25,000,000 ~

### PLD-SPV4221

パルスレーザーアブレーション



超電導研究に / 2段差動排気付/YAGレーザー付  
TMP+RP/カスタム可

¥ 20,000,000 ~